



2012/01/17

薄膜熱物性測定に関するJIS規格制定のお知らせ

2011年12月20日にファインセラミックス薄膜の熱物性測定に関するJIS規格が制定されました。当社では、下記JIS規格に準拠し、薄膜熱物性測定装置「NanoTR」、「PicoTR」および受託分析・測定サービスをより高精度に提供してまいります。

規格番号：JIS R 1689

ファインセラミックス薄膜の熱拡散率の測定方法—パルス光加熱サーモリフレクタンス法

この規格は、透明基板上に成膜された厚さが100 nm～数 μ mの均質なファインセラミックス薄膜の室温付近の膜厚方向の熱拡散率の測定方法のうち、パルス光加熱サーモリフレクタンス法について標準化を行い、生産及び使用の合理化、品質の向上を図るために制定するものである。

規格番号：JIS R 1690

ファインセラミックス薄膜と金属薄膜との界面熱抵抗の測定方法

この規格は、主に厚さ10 nm～100 nmの均質なファインセラミックス薄膜の両側に厚さ約100 nmの金属薄膜が施された3層薄膜に対し、面積熱拡散時間法によるファインセラミックス薄膜の膜厚方向の熱拡散率及び金属薄膜並びにファインセラミックス薄膜間の界面熱抵抗を測定する方法について標準化を行い、生産及び使用の合理化、品質の向上を図るために制定するものである。



薄膜熱物性測定装置 *NanoTR*

本件に関するお問い合わせ

株式会社ピコサーム

〒305-0047 茨城県つくば市千現 2-1-6

Tel. 029-828-7540 Fax. 029-828-7541 <http://www.pico-therm.com>